

**Zeitschrift:** Mittex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa

**Herausgeber:** Schweizerische Vereinigung von Textilfachleuten

**Band:** 109 (2002)

**Heft:** 1

**Artikel:** Antihaft- und Selbstreinigungseffekt durch NanoSphere

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-677359>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

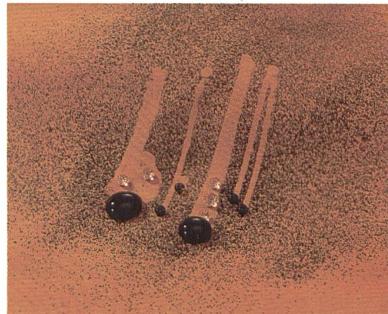
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 06.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## Antihaft- und Selbstreinigungs-effekt durch NanoSphere®

**Der natürliche Antihaft- und Selbstreinigungseffekt der neuen NanoSphere®-Imprägnierung von Schoeller hat auch die Textildesign-Jury des «Design Preis Schweiz 2001» überzeugt. Am 2. November wurde Schoeller Switzerland in Langenthal für die zukunftsweisende Entwicklung auf Basis der Nanotechnologie ausgezeichnet.**

Die Funktion des neuen Wasser und Schmutz-abweisenden Ausrüstungsverfahrens ist vergleichbar mit Phänomenen aus der Natur: Bestimmte Pflanzenblätter, Käferpanzer und Insektenflügel bleiben immer sauber, weil Schmutzteilchen auf ihrer rauhen und strukturierten Oberfläche so schlecht haften, dass schon leichter Regen genügt, um sie fortzuwaschen. Dieses Prinzip wird durch die NanoSphere®-Technologie auf Textilien übertragen, indem eine spezielle, dreidimensionale Oberflächenstruktur angelegt wird. Aufgrund der geringen Berührungsfläche finden Schmutzpartikel keine Haftung. Sie bleiben an einem Wassertropfen hängen und werden einfach mitgerissen, sobald das Wasser abperlt.

### Völlig neue Eigenschaften

«Die mikroskopisch kleine Dimension der Nanotechnologie erlaubt solche Oberflächenveränderungen und wird im Textilbereich ganz generell zu völlig neuen Eigenschaften führen», so Hans-Jürgen Hübner, CEO von Schoeller. «Wir stehen mit dieser Neuheit und Nachfolgeproduktien auf Nanoebene am Anfang einer fas-

zinierenden neuen Ära.» Das mit einer Anerkennung ausgezeichnete, innovative und effiziente Verfahren ist umweltfreundlich und regeneriert sich außerdem praktisch selbstständig. Es wurde in der Schweiz unter Vorgabe des bluesign®-Standards entwickelt und von Schoeller in die Praxis umgesetzt. Schoeller-Textillien mit NanoSphere®-Ausrüstung sind seit Anfang 2001 erhältlich.



*Von der Natur – für die Natur: Bestimmte Pflanzenblätter oder Insektenflügel bleiben immer sauber, weil Schmutz auf ihrer strukturierten Oberfläche nicht haften kann.*

### Aussergewöhnliche Designideen

Der im 2-Jahres-Rhythmus ausgeschriebene Design Preis Schweiz würdigte aussergewöhnliche Designideen in den Kategorien Industrial Design, Textile Design, Interaction Design, Service Design, und vergibt den Willy Guhl-Nachwuchspreis sowie einen Verdienstpreis an eine Person oder Institution, die sich um die Förderung des Designs in der Schweiz verdient gemacht hat. Die aus sechs internationalen Design-Fachleuten zusammengesetzte Jury, hatten in diesem Jahr über insgesamt 534 eingereichte Objekte aus 20 Ländern zu entscheiden. Es wurden im Ganzen acht Preisträger und ein Verdiensträger ermittelt sowie 68 Anerkennungen ausgesprochen. Nach 1997 und 1999 wurde die Innovationskraft des Schweizer Textiltechnologieunternehmens in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge gewürdigt.



*Der natürliche Antihaft- und Selbstreinigungseffekt der neuen NanoSphere®-Imprägnierung von Schoeller*

Dieses effiziente und umweltfreundliche Funktionsprinzip wird von Schoeller mittels moderner Nanotechnologie auf Textiloberflächen übertragen.

Trademarks: NanoSphere® - Schoeller Textil AG

## Uster® Statistics 2001

Anlässlich der ITMA ASIA in Singapore wurden die neuen USTER® STATISTICS 2001 der Fachwelt vorgestellt. Diese statistische Übersicht enthält Klassifikationsdaten für Fasern, Faserbänder, Vorgarne und Garne. Der Anwendungsbereich wurde um Informationen über Fasereigenschaften, wie Reifegrad, Faserfeinheit und Anteil an unreifen Fasern, sowie über Gareigenschaften, wie Garndurchmesser, Querschnittsform, Garndichte, sowie Anzahl Staub- und Trashpartikel erweitert. Weiterhin wurde neu zwischen Strick- und Webgarnen unterschieden. Die USTER® STATISTICS 2001 stehen entweder auf CD zur Verfügung oder können auf der Website der Firma, <http://www.uster.com> abgerufen werden.

